

# ODHAD KONCENTRÁCIE DONOROV V LiNbO<sub>3</sub>:Fe NA ZÁKLADE VYŠETROVANIA FOTOREFRAKTÍVNEHO JAVU

## AN ESTIMATION OF DONOR CONCENTRATION IN LiNbO<sub>3</sub>:Fe USING THE PHOTOREFRACTIVE EFFECT

Norbert Tarjáni, Ivan Turek

*Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská Univerzita, Veľký diel, 010 26 Žilina*

**Abstrakt:** V práci sa prezentujú výsledky experimentálneho vyšetrovania záznamu optického poľa vytvoreného prostredníctvom fotorefraktívneho javu v LiNbO<sub>3</sub> dopovanom železom. Časové závislosti amplitúdy záznamu získaných pri rôznych intenzitách zaznamenaného poľa ukazujú, že štandardne používaný model procesu vzniku záznamu v LiNbO<sub>3</sub> je treba modifikovať zavedením ďalšej (záchytnej) hladiny. Jednoduchá približná analýza takto modifikovaného modelu umožnila na základe nameraných závislostí odhadnúť koncentráciu obsadenia donorov v skúmanom materiáli.

**Summary:** Results of an experimental investigation of optical field record created by photorefractive effect in iron doped LiNbO<sub>3</sub> is presented in the paper. According to time dependences of record amplitude obtained at different intensities of recorded field it was shown that the standard model of process description should be modified by adding another level (trap level). A simple and approximative analyse of the suggested model with respect to experimentally obtained results allowed to estimate the concentration of occupied donor centres in investigated material.

### 1. ÚVOD

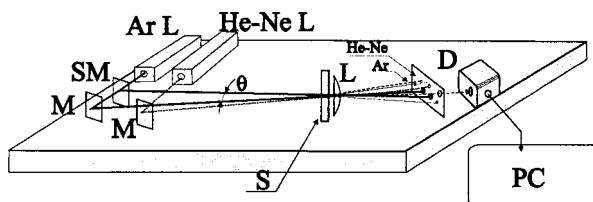
Z veľkého počtu prác týkajúcich sa záznamu optických polí v LiNbO<sub>3</sub> sa väčšina venuje technike vytvárania záznamov so zameraním sa na dosiahnutie čo najväčszej hustoty záznamu, časovej stability záznamu, odolnosti voči mazaniu pri čítaní informácie ako i ďalším technickým aplikáciám, ale len relatívne malá časť sa zaobráňa fyzikálnym popisom procesov prispievajúcich k javu, ktorý sa označuje ako fotorefraktivita [1,2,3,4]. V tejto práci sa preto chceme venovať práve mechanizmu vzniku záznamov optických polí.

Ukazuje sa, že záznamy vytvorené pri malých expozíciiach (expozíciou rozumieme súčin intenzity osvetlenia a doby vytvárania záznamu) neposkytujú dostatok informácií pre podrobnejšie vyšetrenie procesu. Pri malých expozíciiach je amplitúda záznamu lineárnu funkcioou času a pozorovaný vznik záznamu môžeme charakterizovať jediným parametrom – „citlivosťou“. Z toho dôvodu sme vyšetrovali vytváranie záznamov pri vysokých expozíciiach, čo umožňuje získať viac informácií o procese záznamu. Na základe analýzy experimentálne získaných závislostí intenzity fotorefraktívneho záznamu od času je možné (za určitých predpokladov a zjednodušení) odhadnúť i niektoré materiálové parametre konkrétnej vzorky kryštálu.

### 2. POPIS EXPERIMENTU A JEHO VÝSLEDKY

Pri experimentálnom vyšetrovaní sme mali k dispozícii vzorky LiNbO<sub>3</sub>:Fe od firmy KRYTUR Turnov, CZ. Experimenty boli realizované zariadením pre holografické vyšetrovanie fotorefraktívneho javu, schéma

ktorého je na obr.1. Až na He-Ne laser určený pre registráciu záznamu je zhodné so zariadením použitým v našej predchádzajúcej práci [5]. Pri vyšetrovaní bolo štandardne zaznamenané optické pole, ktoré vzniklo interferenciou dvoch koherentných zvázkov Ar lasera s vlnovou dĺžkou 488 nm. Tieto lúče sa v mieste vzorky prekrývali s malým uhlom (cca 0.004 rad), v dôsledku čoho vytvárali optické pole s harmonickou závislosťou od súradnice  $x$ . Vzorka bola orientovaná tak, že jej kryštalografická os  $c$  bola rovnobežná so smerom gradientu osvetlenia  $I(x)$ . Pre čítanie vytvoreného záznamu sa spravidla používal zvázok He - Ne lasera s vlnovou dĺžkou 633 nm. Intenzita tohto čítacieho lúča bola zvolená tak, aby boli jeho prípadné účinky na čítaný záznam čo najmenšie, ale aby zároveň poskytoval dostatočne intenzívne difragované zvázky.



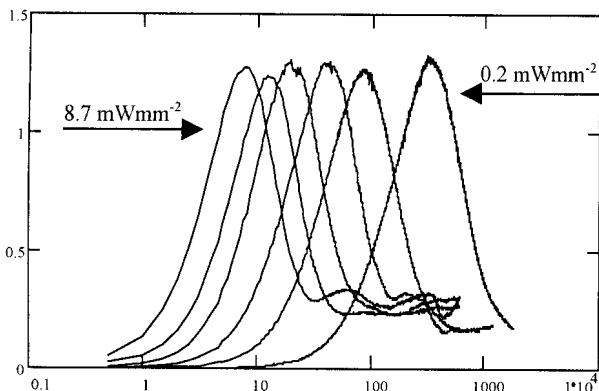
Obr. 1. Schéma zariadenia pre holografické vyšetrovanie fotorefraktívneho javu.

Fig. 1. A scheme of the experimental set-up for holographic investigation of photorefractive effect..

Kedže záznam bol vytvorený periodickým optickým poľom, má charakter mriežky a dochádza na ňom k difrakcii ako lúčov Ar lasera, ktoré záznam vytvárajú (tzv. samodifrakcia), tak i čítacieho lúča He-Ne lasera. Pri čítaní bol použitý lúč z He-Ne lasera s vektorom

polarizácie rovnobežným s kryštalografickou osou *c* kryštálu (mimoriadna polarizácia).

Hlavná pozornosť bola venovaná časovej závislosti intenzity difragovaného lúča pri veľkých expozičiach\*. Merania sme mnohonásobne opakovali za rovnakých podmienok na rôznych miestach vzorky. Aby sme mohli na jednej vzorke urobiť viacero záznamov, pomocou kruhovej clonky sme zmenšili priemer použitých zväzkov na cca 1,5 mm. Po „zaplnení“ vzorky záznamami sme vytvorené záznamy vymazali temperáciou vzorky [6] pri teplote 110 °C po dobu cca 30 minút. Osvetlením vzorky čítacím lúčom bolo možné sa presvedčiť, že záznamy takto temperáciou boli naozaj vymazané. Reprodukovateľnosť meraní, ktoré boli uvedeným spôsobom uskutočnené, nie je absolútна. Krivky získané pri opakovaní sa líšili cca o 10% - 15% avšak ich charakter zostával rovnaký. Na základe toho sa môžeme domnievať, že výsledky sú v rámci spomenutej presnosti spoľahlivé.



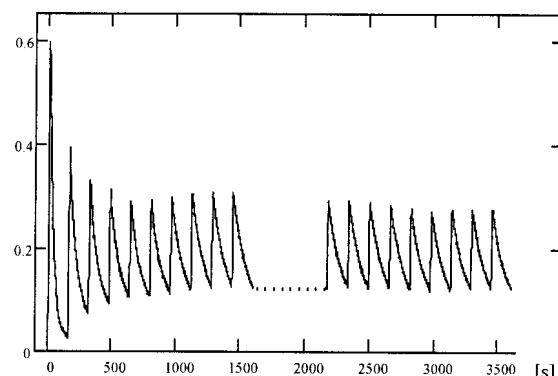
Obr. 2. Intenzity difragovaných lúčov (v relatívnych jednotkách) v závislosti od doby expozicie pri rôznych intenzitách zaznamenávaného pola. Krvíky sú pre intenzity pola  $8,7 \text{ mWmm}^{-2}$ ,  $5,2 \text{ mWmm}^{-2}$ ,  $3,5 \text{ mWmm}^{-2}$ ,  $1,7 \text{ mWmm}^{-2}$ ,  $0,9 \text{ mWmm}^{-2}$  a  $0,2 \text{ mWmm}^{-2}$ .

Fig. 2. Temporal dependences of diffracted beams intensities at different intensities of recorded field. The plotted curves are for following intensities:  $8,7 \text{ mWmm}^{-2}$ ,  $5,2 \text{ mWmm}^{-2}$ ,  $3,5 \text{ mWmm}^{-2}$ ,  $1,7 \text{ mWmm}^{-2}$ ,  $0,9 \text{ mWmm}^{-2}$  a  $0,2 \text{ mWmm}^{-2}$ .

\* Amplitúda svetelného zväzku vytvoreného difrakciou zo zväzku, ktorým sa záznam osvetľuje je úmerná intenzite záznamu, takže intenzita difrakciou vytvoreného zväzku je pri lineárnom náreste amplitúdy záznamu úmerná štvorca amplitúdy záznamu a teda štvorca expozičie. Kvadratickú závislosť intenzity difragovaného zväzku od expozičie považujeme preto za kritérium, podľa ktorého hodnotíme expozičiu ako „malú“ (lineárny záznam), resp. pri prekročení tejto oblasti ako „veľkú“. Pri procesoch s fázovou moduláciou, môže k odsklonu od kvadratickej závislosti intenzity difragovaného zväzku dôjsť skôr, než dôjde k nonlinearitám v procese záznamu. Ale i v tomto prípade budeme hovoriť o „veľkých“ expozičiach, keď závislosť intenzity difragovaného zväzku prestane byť kvadratická.

Na obr.2 sú vynesené časové závislosti intenzity prvého difrakčného maxima vytvoreného na zázname harmonického rozloženia intenzity záznamového osvetlenia v  $\text{LiNbO}_3:\text{Fe}$  pri rôznych intenzitách zaznamenávaného pola.

Je známe [6,7,8,9], že záznam optického pola je tiež možné vymazať homogénym svetlom, čo umožňuje niekoľkonásobnú expozičiu v tom istom mieste kryštálu. Priebeh intenzity na zázname difragovaného lúča pri pomerne krátkej a mnohonásobne opakovanej expozičii vzorky  $\text{LiNbO}_3:\text{Fe}$  priestorovo periodickým osvetlením vytvoreným interferenciou dvoch koherentných laserových zväzkov je uvedený na obr.3. Po každej expozičii priestorovo modulovaným osvetlením bolo miesto záznamu následne osvetlené neperiodickým („homogénym“) osvetlením na dobu niekoľkonásobne prevyšujúcu dobu vytvárania záznamu, v dôsledku čoho sa záznam prakticky „vymazal“. Pri ďalšom osvetlení tohto istého miesta kryštálu periodickým poľom sa záznam vytvoril, ale s menšou intenzitou.



Obr. 3. Závislosť relatívnych hodnôt intenzity difragovaného lúča od času pri mnohonásobne opakovanej nahrávaní a optickom „vymazávaní“ záznamu optického pola.

Fig. 3. Time dependence of relative intensities of diffracted beam during multiple recording and optical „erasing“ of the optical field record.

Pri tomto experimente ako mazací lúč bol použitý jeden z lúčov spolupodieľajúcich sa na vytváraní zaznamenávaného interferenčného pola. Ukazuje sa tak, že priebehy pri opakovanej zázname na vzorkách  $\text{LiNbO}_3:\text{Fe}$  majú analogický charakter ako pri „čistých“ vzorkách  $\text{LiNbO}_3$ , ktoré sme uviedli v našej predchádzajúcej práci [5].

### 3. ANALÝZA PROCESU

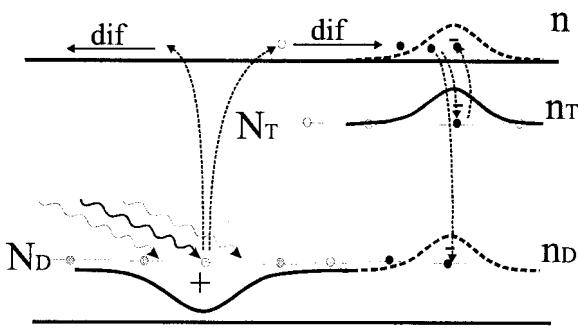
Pri výklade mechanizmu vzniku dlhotrvajúceho záznamu sa predpokladá existencia donorovej hladiny v zakázanom páse dostatočne hlboko na to, aby z nej nedochádzalo k tepelnej excitácii nosičov náboja už pri izbovej teplote [10].

Osvetlením s vlnovou dĺžkou, pri ktorej energia dopadajúcich fotónov je väčšia (alebo rovná) než rozdiel

energie dna vodivostného pásu a donorovej hladiny, dôjde k absorpcii fotónov a excitácii elektrónov do vodivostného pásu a následne k ich záchyту. Pri nehomogénnom osvetlení elektróny vo vodivostnom páse difundujú z miest s vyššou intenzitou osvetlenia do miest s nižšou intenzitou, takže sa vytvorí priestorová závislosť koncentrácie objemového náboja (dôjde k zmene obsadenia donorovej hladiny nosičmi náboja) a vzniká vnútorné elektrostatické pole, ktoré v dôsledku elektrooptického javu vyvoláva lokálnu zmenu indexu lomu kryštálu. Táto zmena indexu lomu vyvolaná osvetlením predstavuje záznam. V našej predchádzajúcej práci [5] bolo na základe jednoduchého rozboru kinetických rovnic popisujúcich uvedený proces ukázané, že záznam je v ustálenom stave jednoznačne určený rozložením koncentrácie elektrónov na donorovej hladine, takže stav predstavujúci záznam nie je závislý od histórie kryštálu. Výsledok experimentu, pri ktorom dochádzalo k opakovanému vytváraniu a mazaniu záznamu na tom istom mieste (obr.3) je však v rozpore s uvedeným záverom, ktorý vyplýva z riešenia rovníc popisujúcich „jednohladinový“ model v ustálenom stave.

Potreba interpretovať pozorovaný pokles citlivosti pri opakovanom nahrávaní a mazaní nás viedla k predpokladu existencie ďalších „záchytných“ centier nachádzajúcich sa v zakázanom páse medzi vodivostným pásmom a donorovou hladinou. Oprávnenosť takého predpokladu vyplýva i z pozorovanej závislosti intenzity difragovaného lúča od času pri rôznych intenzitách zaznamenaných polí (obr.2).

Zo závislostí uvedených na obr.2 je vidieť, že po dostatočne dlhej expozícii dochádza k ustáleniu záznamu, a že táto „ustálená“ hodnota nezávisí od intenzity zaznamenaného poľa. Ustálenie záznamu môže byť spôsobené vytvorením rovnováhy medzi difúznym prúdom a ohmickým prúdom vyvolaným elektrickým poľom, ktoré v dôsledku nehomogenity difúzneho prúdu vzniká. Ustálenie záznamu ale môže byť i dôsledkom vyčerpania donorovej (prímesovej) hladiny.



Obr. 4. Schéma „dvojhadinového“ modelu.  
Fig. 4. A scheme of the „two-level“ model.

Navrhnutý „dvojhadinový“ model (obr.4) je popísaný kinetickými rovnicami, ktoré v prípade, že závislosť intenzity zaznamenaného poľa od súradnice sa redukuje na jeho závislosť od súradnice  $x$ , t.j., že absorpcia

v prostredí je taká malá, že na hrubke vzorky sa zanedbateľne prejavuje, majú tvar:

$$\frac{\partial n_D(t, x)}{\partial t} = -g_D I(x) n_D(t, x) + R_D n(t, x)(N_D - n_D(t, x)) \quad (1)$$

$$\frac{\partial n_T(t, x)}{\partial t} = -g_T I(x) n_T(t, x) + R_T n(t, x)(N_T - n_T(t, x)) \quad (2)$$

$$\frac{\partial n(t, x)}{\partial t} = -\frac{\partial n_D(t, x)}{\partial t} - \frac{\partial n_T(t, x)}{\partial t} - \frac{1}{e} \frac{\partial j_x}{\partial x} \quad (3)$$

Pre prúdovú hustotu a elektrické pole pritom platí:

$$j_x = \sigma E_x + D \frac{\partial}{\partial x}(n(t, x)) \quad (4)$$

$$\frac{\partial E(t, x)}{\partial x} = \frac{\rho(t, x)}{\epsilon} \quad (5)$$

Význam jednotlivých symbolov je nasledovný:  $n_D(t, x)$  je koncentrácia elektrónov na donorovej hladine ako funkcia času a súradnice,  $g_D$  je pravdepodobnosť generácie elektrónu do vodivostného pásu z donorovej hladiny za jednotku času pri jednotkovej intenzite osvetlenia  $I(x)$  a jednotkovej koncentrácií  $n_D(t, x)$ ,  $R_D$  je pravdepodobnosť záchyty na donorovú hladinu za jednotku času pri jednotkovej koncentrácií  $n(t, x)$  a  $n_D(t, x)$ ,  $n(t, x)$  je koncentrácia elektrónov vo vodivostnom páse,  $N_D$  je celková koncentrácia donorov,  $n_T(t, x)$  je koncentrácia elektrónov na záchytných centrách,  $g_T$  je pravdepodobnosť generácie elektrónu do vodivostného pásu zo záchytných centier za jednotku času pri jednotkovej intenzite osvetlenia a jednotkovej koncentrácií  $n_T(t, x)$ ,  $R_T$  je pravdepodobnosť záchyty elektrónu na záchytnom centre za jednotku času pri jednotkovej koncentrácií  $n_T(t, x)$  a  $n(t, x)$ ,  $N_T$  je celková koncentrácia záchytných centier,  $e$  je náboj elektrónu,  $j_x$  je zložka vektora prúdovej hustoty,  $\sigma$  je merná vodivosť,  $E_x$  je zložka vektora elektrického poľa,  $D$  je difúzna konštantá voľných elektrónov vo vodivostnom páse,  $\rho(t, x)$  je celkový objemový náboj a  $\epsilon$  je permitívita daného prostredia. Riešenie rovnic (1) – (5)umožňuje vyjadriť časovú a priestorovú závislosť elektrického poľa  $E(t, x)$ .

Pre vyšetrovanie fotorefraktívneho javu (PRE) holografickou metódou je výhodné použiť ako predlohu pre záznam optické polia s čo najjednoduchšou štruktúrou. Preto sme používali harmonické pole, ktoré vzniklo interferenciou dvoch rovinných koherentných vĺn.

Ako už bolo spomenuté vyššie, záznam periodického optického poľa sa správa ako fázová difrakčná mriežka tvorená oblasťou s priestorovo modulovaným indexom lomu. Z teórie difrakcie [11] je možné ukázať ako sa mení

intenzita jednotlivých difrakčných maxím so zmenou modulácie indexu lomu.

Predpokladajme, že celý proces vzniku záznamu (vzniku elektrického poľa a ako dôsledku modulácie indexu lomu) je lineárnu funkciu času. Intenzity jednotlivých difrakčných maxím môžeme vypočítať z difrakčného integrálu [11]:

$$I(\vartheta, t) = \sin^2\left(\frac{N\pi d \vartheta}{\lambda}\right) / \sin^2\left(\frac{\pi d \vartheta}{\lambda}\right) \times \left( \left| \int_0^d \exp(-ik\Delta\phi(t, x)) \exp(-ik\vartheta\xi) d\xi \right|^2 \right)^2 , \quad (6)$$

kde  $I(\vartheta, t)$  predstavuje smerové rozloženie intenzity difragovaného zväzku v čase  $t$  a v smere určenom difrakčným uhlom  $\vartheta$ ,  $d$  je mriežková konštantá,  $\lambda$  je vlnová dĺžka difragovaného svetla,  $k$  je veľkosť vlnového vektoru a  $\Delta\phi(t, x)$  znamená zmenu fázy vyvolanú zmenou indexu lomu zapríčinenou elektrickým poľom  $E(t, x)$ . Ak je zmena indexu lomu spôsobená lineárnym elektrooptickým javom, pre zmenu fázy pri usporiadaní experimentu odpovedajúcemu nášmu platí [10,13]:

$$\Delta\phi(t, x) = \frac{1}{2} n_e^3 r_{33} L E_3(t, x) , \quad (6a)$$

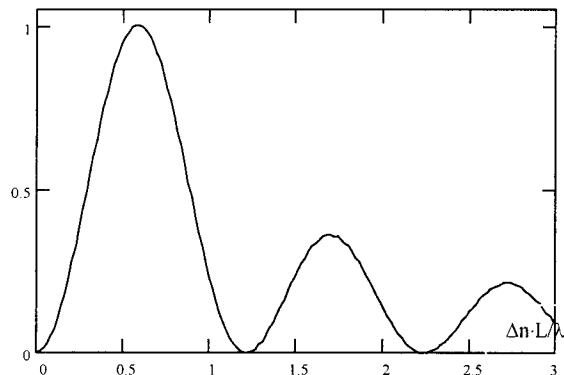
kde  $n_e$  je index lomu prostredia vtedy, keď elektrické pole je rovné nule,  $r_{33}$  je príslušný prvok elektrooptického tenzoru,  $L$  je hrúbka vzorky a  $E_3$  je zložka elektrického poľa v smere kryštalografickej osi  $c$ .

Porovnaním priebehov intenzity vypočítaných zo vzťahu (6) (obr.5) s experimentálne získanými krivkami (obr.2) vidíme, že ich charakter je rovnaký len v prvej fáze expozície. Z pozorovaného nesúlada sa dá usudzovať, že vývoj záznamu nie je v čase lineárny (resp. môžeme ho považovať za lineárny len veľmi krátku dobu po začatí nahrávania).

Intenzita difragovaných lúčov sa v čase mení a ako možno vidieť z obr.2 najprv intenzita narastá, dosiahne maximálnu hodnotu a s narastajúcim časom klesá až na určitú, takmer ustálenú hodnotu. Tento fakt by mohol naznačovať, že existuje obmedzujúci mechanizmus, ktorý spôsobuje, že index lomu sa v čase mení inak ako lineárne. Nie je nerozumné predpokladať, že dlhodobým svietením sa dosiahne istá maximálna hodnota zmeny indexu lomu. V prípade, že ustálený stav je dôsledkom kompenzácie difúzneho prúdu prúdom ohmickým, by maximálna hodnota elektrického poľa v zázname (maximálna modulácia indexu lomu) bola úmerná amplitúde intenzity zaznamenaného optického poľa. Ak ale dojde v priebehu tvorby objemového náboja k vyprázdeniu donorovej hladiny, z ktorej sa nosiče osvetlením čerpali, dojde k zastaveniu rastu intenzity elektrického poľa skôr, ako sa dosiahne stav rovnováhy medzi difúznym a ohmickým prúdom. Je evidentné, že pri istej koncentrácií nosičov náboja na prímesových centrach

pred započatím vytvárania záznamu  $n_{D0}$  existuje istá prahová hodnota intenzity optického poľa  $I_{th}$  taká, že pre  $I >> I_{th}$  sa obmedzenie nárastu intenzity elektrického poľa vyprázdzovaním donorovej hladiny prejavuje a pre  $I << I_{th}$  ohmický prúd dosiahne hodnotu difúzneho prúdu skôr ako k obmedzeniu dojde.

Závislosť amplitúdy modulácie indexu lomu od intenzity zaznamenaného optického poľa tak poskytuje principiálnu možnosť určiť, v ktorej oblasti intenzít sa experiment uskutočňuje. Z toho dôvodu sme závislosť intenzity difragovaného lúča od intenzity zaznamenaného optického poľa (obr.2) premerali v pomerne širokom intervale intenzít (cca  $0,2 \text{ mWmm}^{-2}$  – cca  $9 \text{ mWmm}^{-2}$ ). Pozorovaná nezávislosť ustálenej hodnoty od intenzity zaznamenaného optického poľa presvedčivo ukazuje, že v celej tejto oblasti intenzít sú intenzity optického poľa značne väčšie ako je prahová hodnota  $I_{th}$ . Znamená to, že v priebehu vykonaných experimentov bol ohmický prúd značne menší než difúzny prúd.



Obr. 5. Závislosť relatívnych hodnôt intenzity prvého difrakčného maxima fázovej harmonickej mriežky od amplitúdy modulácie.

Fig. 5. Relative values of intensity of the first diffracted maximum generated by the harmonic phase grating as a function of amplitude of the refractive index modulation.

Vyprázdenie donorovej hladiny ale znamená, že nosiče, ktoré pôvodne boli na donorovej hladine, sú zachytené inými (záchytnými) centrami. Nezávislosť amplitúdy ustáleného záznamu od intenzity osvetlenia tak ukazuje, že pre proces vytvárania záznamu vo vyšetrovanej vzorke je záhyt nosičov na záchytnej hladine rozhodujúci.

Predpokladajme teda, že  $R_D N_D \ll R_T N_T$ . Rovnica (1) tak nadobudne tvar

$$\frac{\partial n_D(t, x)}{\partial t} = -g_D I(x) n_D(t, x) . \quad (7)$$

Pre závislosť populácie na donorovej hladine od času tak bude platíť

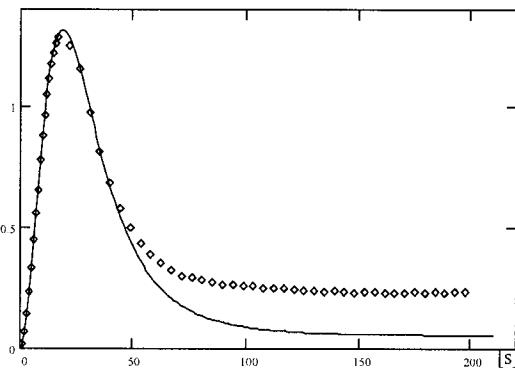
$$n_D(t, x) = n_{D0} \exp\left(-\frac{t}{\tau(x)}\right) , \quad (8)$$

čo znamená, že hladina sa bude v čase exponenciálne vyprázdňovať s časovou konštantou  $\tau$  blízkou hodnote

$$\tau = \frac{1}{g_D I(x)}, \text{ čo možno nahradíť}$$

$$\tau = \frac{1}{g_D I_m} \quad (9)$$

kde  $I_m$  je intenzita svetla v interferenčnom maxime, pretože práve v tejto oblasti dochádza k najväčšej generácii elektrónov.



Obr. 6. Porovnanie nameraných závislostí intenzity prvého difrakčného maxima od času s hodnotami vyplývajúcimi zo vzťahu (6) pre fázovú mriežku, keď amplitúda modulácie indexu lomu sa asymptoticky blíži k nasýtenej hodnote. ◊ - namerané hodnoty, — - vypočítané hodnoty (v relatívnych jednotkách).

Fig. 6. Comparison between measured dependences of the first diffracted maximum and values following from the relation (6) when the amplitude of the refractive index modulation is approaching asymptotically a saturate value. ◊ - measured values, — - calculated values (in relative units).

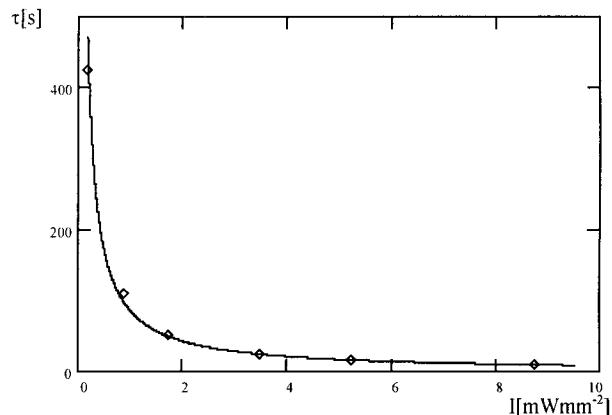
Pretože amplitúda modulácie indexu lomu podľa (6a) je úmerná elektrickému poľu, ktoré závisí od koncentrácie nábojov na jednotlivých hladinách, exponenciálny charakter vyplývajúci z (8) sa prejaví i na koncentráции elektrónov vo vodivostnom pásu a záhytnej hladine a z toho dôvodu i na amplitúde modulácie indexu lomu, pre ktorú potom môžeme použiť približné vyjadrenie

$$\Delta n = \Delta n_{\max} \left( 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right) \sin(Kx), \quad (10)$$

kde  $\Delta n_{\max}$  je maximálna zmena indexu lomu,  $t$  je čas,  $\tau$  je časová konštantă procesu,  $K$  je priestorová frekvencia charakterizujúca mriežku.

Dosadením (10) do (6) a vyjadrením  $\Delta\phi(t,x)$  dostaneme závislosť, ktoré sa relatívne dobre zhodujú s experimentálne zistenými závislosťami (obr.6). Hodnoty  $\tau$  pre rôzne hodnoty intenzity zaznamenaného poľa boli určené fitovaním. Podľa (9) hodnoty  $\tau$  majú byť nepriamo úmerné intenzite poľa, čo získané hodnoty plne

potvrdzujú (obr.7). Na tomto obrázku je pre porovnanie vynesená i funkcia  $1/g_D I_m$ , pre hodnotu  $g_D=10^{-5}$ .



Obr. 7. Závislosť časovej konštanty dosahovania ustálenej hodnoty záznamu od intenzity záznamovaného poľa.

Fig. 7. Time constant of reaching the saturate value of the record in dependence on intensity of recorded field.

Dobrá zhoda (9) s nameranou závislosťou  $\tau$  od  $I$  je významná i preto, že umožňuje v spojení s meraním koeficientu absorpcie určiť počiatočnú koncentráciu nosičov na donorovej hladine.

Vychádzajúc z predpokladu, že k absorpcii svetla dochádza tým istým mechanizmom ktorým sa nosíce z donorovej hladiny excitujú do vodivostného pásu, a že sa jedná o jednofotónový proces, môžeme  $\frac{\partial n_f}{\partial t}$  v (7) nahradíť  $\frac{\partial n_f}{\partial t}$ , pričom koncentrácia fotónov je

$$n_f = \frac{I}{h\nu c}, \quad (11)$$

kde  $h$  je Planckova konštanta,  $\nu$  frekvencia svetla a  $c$  rýchlosť svetla v danom prostredí.

Využitím definičného vzťahu pre koeficient absorpcie  $\alpha$ :

$$\frac{\partial I}{\partial x} = \alpha I$$

a vzťahov (7) a (11) tak pre počiatočnú koncentráciu  $n_{D0}$  dostávame

$$n_{D0} = \frac{\alpha}{g_D} \frac{1}{h\nu}. \quad (12)$$

Priamym meraním priepustnosti vzorky pre svetlo s vlnovou dĺžkou 488 nm sme určili, že koeficient absorpcie v použitom materiáli LiNbO<sub>3</sub>:Fe je približne rovný 1,27 cm<sup>-1</sup>. Po dosadení hodnôt  $\alpha$  a  $g_D$  do (12) dostávame pre  $n_{D0}$  hodnotu  $5 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$ . Táto hodnota je v dobrej zhode s údajom výrobcu. Výrobca pre

konzentráciu Fe vo vzorke udáva hodnotu 400 ppm, z ktorej vyplýva koncentrácia rádu  $10^{24} \text{ m}^{-3}$ .

#### 4. ZÁVER

Z porovnania závislostí intenzity difragovaných lúčov od času vyplývajúcich z teórie difrakcie s experimentálne zistenými závislosťami vyplýva, že pri vysokých expozíciách dochádza k dosiahnutiu ustálenej hodnoty záznamu, ktorá nezávisí od intenzity zaznamenávaného optického pola. Takéto správanie sa zhoduje s priebehmi, ktoré vyplývajú z predloženého dvojhlininového modelu za predpokladu, že pravdepodobnosť záchytu na záchytných centrách je väčšia ako na prímesových centrách ( $R_D N_D \ll R_T N_T$ ). Tento predpoklad o dominantnom vplyve záchytných centier na priebeh procesov dovoľuje určiť generačný faktor nosičov (parameter  $g_D$ ) a na základe toho zo známej hodnoty koeficientu absorpcie zaznamenávaného svetla určiť pôvodnú koncentráciu nosičov na donorových centrách. Relativne dobrá (rádová) zhoda takto určenej koncentrácie iónov Fe určených výrobcom potvrzuje opodstatnenosť použitia dvojhlininového modelu pri popise vzniku záznamov vo vyšetrovanom materiáli a tým i možnosť využitia fotorefraktívneho javu na určenie koncentrácie prímesí.

#### LITERATÚRA

- [1] CHEN, F. S.: *Optically induced change of refractive indices in  $LiNbO_3$  and  $LiTaO_3$* , Journal of Applied Physics **40**, 3389 (1969)
- [2] JOHNSTON, W. D. Jr.: *Optical index damage in  $LiNbO_3$  and other pyroelectric insulators*, Journal of Applied Physics **41**, 3279 (1970)
- [3] YUTAKA OHMORI, YOSHIYUKI YASOJIMA, YOSHIO INUISHI: *Japanese Journal of Applied Physics* **14**, 1291, 1975
- [4] AVANESYAN, G. T. - VARTANYAN, E. S. - MIKAELYAN, R. S. - HOVSEPYAN, R. K. - POGOSYAN, A. R: *Mechanisms of photochromic and photorefractive effects in doubly doped Lithium Niobate Crystals*, Phys. Stat. Sol. (a) **126**, 245 (1991)
- [5] TUREK, I. - TARJÁNYI, N. - MUSIL, C. - ŠTELINA, J. - GRONDŽÁK, K.: *Poznámky k popisu fotorefraktívneho javu v  $LiNbO_3$* , JMO **7** - 8 (2000) 205 - 207
- [6] ARIZMENDI, L. - TOWNSEND, P. D. - CARRASCOSA, M. - BAQUEDANO, J. - CABRERA, J. M. - *Photorefractive fixing and related thermal effects in  $LiNbO_3$* , J. Phys.: Condens. Matter **3** (1991) 5399 - 5406
- [7] BUSE, K. - JERMANN, F. - KRÄTZIG, E.: *Infrared holographic recording in  $LiNbO_3:Fe$  and  $LiNbO_3:Cu$* , Optical Materials **4** (1995) 237 - 240
- [8] YOUWEN LIU, LIREN LIU, LIANGYING XU: CHANGHE ZHO: *Experimental study of non-volatile holographic storage in doubly - and triply - doped lithium niobate crystals*, Optics Communications **181** (2000) 47 - 52
- [9] YOUWEN LIU, LIREN LIU, DE'AN LIU, LIANGYING XU, CHANGHE ZHOU: *Intensity dependence of two - center nonvolatile holographic recording in  $LiNbO_3:Cu:Ce$  crystals*, Optics Communications **190** (2001) 339 - 343
- [10] POCHI YEH: *Introduction to photorefractive nonlinear optics*, John Wiley & Sons, Inc., New York 1993
- [11] BORN, M. - WOLF, E.: *Principles of optics*, Moscow 1970
- [12] ČTYROKÝ, J. - HÜTTEL, I. - SCHRÖFEL, J. - ŠIMÁNKOVÁ, L.: *Integrovaná optika*, SNTL Praha, 1986
- [13] NAY, J.: *Fizicheskie svojstva kristallov*, Moskva 1960